

請求の範囲

- [請求項1] Ruを主成分とするスパッタリングターゲットであって、 B_2O_3 よりも高い融点をもち且つホウ素を含む複合酸化物を含有する、該ターゲット。
- [請求項2] 請求項1に記載のスパッタリングターゲットであって、Bの含有量が0.01wt%以上である、該ターゲット。
- [請求項3] 請求項1又は2に記載のスパッタリングターゲットであって、相対密度が90%以上である、該ターゲット。
- [請求項4] 請求項1～3のいずれか1項に記載のスパッタリングターゲットであって、RuとBとO以外に、構成元素として、Co、Cr、Mn、及びTiから選択される1種以上を更に含む、該ターゲット。
- [請求項5] 請求項1～4のいずれか1項に記載のスパッタリングターゲットであって、前記複合酸化物の融点が750℃以上である、該ターゲット。
- [請求項6] 請求項1～5のいずれか1項に記載のスパッタリングターゲットであって、前記複合酸化物が $Co_2B_2O_5$ 、 $CrBO_3$ 、 $TiBO_3$ 及び $Mn_3B_2O_6$ から成る群から選択される1種以上である、該ターゲット。
- [請求項7] スパッタリングターゲットの製造に使用するための複合酸化物の粉体であって、前記複合酸化物が、 B_2O_3 よりも高い融点をもち且つホウ素を含む複合酸化物である、該粉体。
- [請求項8] 請求項7に記載の粉体であって、前記複合酸化物の融点が750℃以上である、該粉体。
- [請求項9] 請求項7又は8に記載の粉体であって、前記複合酸化物が、 $Co_2B_2O_5$ 、 $CrBO_3$ 、 $TiBO_3$ 及び $Mn_3B_2O_6$ から成る群から選択される1種以上である、該粉体。
- [請求項10] 請求項7～9のいずれか1項に記載の粉体であって、比表面積が0.5～80m²/gである、粒径が0.3～15μmである及び／又は不純物としての濃度が10000wtppm以下である、該粉体。